Abstract attacked

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-6277

(43)公開日 平成8年(1996)1月12日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 3 G 5/06 15/04 380

111

D/1132/11/2017

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平6-140362

(71)出願人 000001270

コニカ株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

(22)出顧日 平

平成6年(1994)6月22日

(72)発明者 大柴 武雄

東京都八王子市石川町2970番地コニカ株式

会社内

(72)発明者 武居 良明

東京都八王子市石川町2970番地コニカ株式

会社内

(54) 【発明の名称】 画像形成方法

(57)【要約】

【目的】 本発明の目的は、高速での画像形成が可能であり、かつ長期に亘る反復像形成で疲労劣化がなく、高画質が安定して得られ、特に赤画像を含む原稿の再現性に優れた画像形成方法を提供することにある。

【構成】 特定構造 $Cu-K\alpha$ 線に対するX線回折スペクトルのブラッグ角 2θ が 6.3 ± 0.3 ° , 12.4 ± 0.2 ° , 25.3 ± 0.2 ° 及び 27.1 ± 0.2 ° にピークを有すると共に、 12.4 ± 0.2 ° に最大ピーク強度を有し、該ピークの半値幅が0.65° 以上であり、かつ 11.5 ± 0.2 ° に明瞭なピークを有していない結晶構造のペリレン顔料を電荷発生物質として含有する感光層を有する感光体が用いられ、該感光体上に680nm以下の波長成分を主成分とし、750nmの長波長光成分が10%以下にカットされた像露光を施して画像形成を行う画像形成方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性支持上に少なくとも下記一般式 [I] 及び/又は一般式 [II] で表され、かつ $Cu-K\alpha$ 線 に対するX線回折スペクトルのブラッグ角2θが6.3± 0.3°, 12.4±0.2°, 25.3±0.2°及び27.1±0.2°にピ ークを有すると共に、12.4±0.2°に最大ピーク強度を 有し、該ピークの半値幅が0.65°以上であり、かつ11.5 ±0.2° に明瞭なピークを有していない結晶型を有する ペリレン顔料を電荷発生物質として含有する感光層を設* 一般式〔I〕

*けて成る感光体上に一様な帯電を付与した後、600nmに おける分光透過率が50%以上であり、680nmにおける分 光透過率が50%以下であるフィルターを用いて光源光又 は光源光と原稿画像に照射して得た反射光の長波長成分 をカットして得た光を用いて像露光を施し、前記感光体 上に静電潜像を形成する工程を有することを特徴とする 画像形成方法。

【化1】

-- 松式 (II)

$$z \xrightarrow{N} z$$

(式中2は置換もしくは無置換の複素環を形成するのに必要な

原子群を表す。)

【請求項2】 前記カットフィルターの600nmにおける 分光透過率が80%以上であり、680nmにおける分光透過 率が50%以下であることを特徴とする請求項1に記載の 画像形成方法。

【請求項3】 前記カットフィルターの750nmにおける 分光透過率が10%以下であることを特徴とする請求項1 又は2に記載の画像形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は選択された特定の電荷発 生物質を含む有機感光体を用いると共に、特に制限され た波長域の光を用いて像露光を施す画像形成方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】一般にカールソン法による電子写真画像 形成は、帯電器により感光体表面に一様な帯電を付与し た後、例えばハロゲンランプ、蛍光灯等の光源光を原稿 画像に照射して得た反射光を露光し、像様に電荷を消去 40 して静電潜像を形成し、該潜像をトナー現像し、得られ たトナー像を紙等の転写材に転写、定着して行われる。

【0003】近時、複写機等の普及に伴い高速化が要請 され、そのためには高感度感光体の開発、特に高感度電 荷発生物質の開発が必要とされている。このような電荷 発生物質は通常光吸収効率が大で高感度特性を発揮する ため、光吸収波長域がブロードとされ、赤色部(600~7 00nm) 又はそれ以上の赤外部に及ぶものが多い。

【0004】ところが複写機等による通常の画像形成で は、カラー原稿等の色彩画像は別として、黒、赤、青等※50

※の原稿が大半であり、露光光が600m以上の波長成分を 多く含むと、原稿中の赤色部が複写画像中で欠落すると 云う問題を生ずる。そのため従来、像露光の光路中にい わゆる赤外カットフィルターが設けられている。

【0005】この赤外カットフィルターの使用により、 感光体本来の感度特性はその分制限を受けるが、それで もなお前記複写機等の高速化に対応できる高感度の感光 30 体の開発、特に電荷発生物質の開発が必要不可欠とされ ている。

【0006】更には、複写機等において前記帯電、露 光, 現像, 転写の工程を多数回繰り返して多数枚のコピ ーを高速で形成するケースが多く、その際の感光体の高 耐久性が要請されている。

【0007】従来、高感度特性を有する感光体として、 例えば特開平2-201376号公報及び特開平2-306250号公報 等に記載されるセレン、ヒ素系無機感光体があるが、該 感光体ではセレン、ヒ素共に毒性が強く、環境衛生上有 害であり、加工技術が難しくコスト高であり、しかも耐 湿性が悪いなどの欠点を有している。

【0008】そこで無害で加工性が容易かつ低コスト で、しかも耐湿性に優れた有機感光体の開発が進められ ており、中でも電荷発生機能を電荷発生物質に分担さ せ、電荷輸送機能を電荷輸送物質に分担させた機能分離 型の有機感光体が優れている。このような有機感光体で は、電荷発生物質及び電荷輸送物質の選択の自由度が大 きく、希望する特性に照らして前記各機能を十分発揮で きる物質を広い範囲から選択できるので、電子写真性能 に優れて高感度、高耐久性の感光体の開発が期待され

る。特に電荷発生物質の選択が重要であり、有力な電荷 発生物質として、例えば特開昭50-70232号、特開昭58-1 44358号、特開昭60-196772号の各公報記載のビスアゾ顔 料、特開昭55-11398号、特開昭58-182639号、特開昭64-17060号の各公報記載のフタロシアニン系顔料等が知ら れている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら本発明者 等の研究によれば、前記各顔料を用いた感光体の何れも えば中速機又は高速機で像形成を行った場合感度不足と なることが多かった。又、従来より有機感光体の高感度 化の努力がなされているが、一般に高感度となる程繰り 返し像形成の際の疲労劣化が多くなり、耐久性が低下す ることが知られており、高感度特性と高耐久性を共有す る感光体の開発が要望されている。

【0010】前記複写画像の赤色部の欠落を防止するた め露光光路中に設けられる赤外カットフィルターは種類 が極めて多く、従来使用の赤外カットフィルターには長 波長成分のみでなく、600m以下の短波長側も相当量カ ットしてしまい、感光体の高感度を阻害するフィルター であるとか、700nm以上の長波長領域にカットされない 領域を有し、赤色部の画像濃度が不足するようなフィル ターが用いられるケースが多かった。

【0011】本発明は前記実情に鑑みて提案されたもの* -般式〔1〕

*であり、その目的とするところは、高感度かつ高耐久性 の感光体を用いると共に、適正な長波長光カットフィル ターを用いて画像形成を行い、原稿画像の赤色部の欠落

がなく、高速での反復する画像形成においても高濃度、 高画質が安定して得られる画像形成方法を提供すること にある。

[0012]

【課題を解決するための手段】前記目的は、導電性支持 上に少なくとも下記一般式[I]及び/又は一般式[I が、赤外カットフィルターを併用した露光系を用いて例 10 1]で表され、かつCu-Kα線に対するX線回折スペクト ルのブラッグ角 2 θが6.3±0.3°, 12.4±0.2°, 25.3 ±0.2°及び27.1±0.2°にピークを有すると共に、12.4 ±0.2°に最大ピーク強度を有し、該ピークの半値幅が 0.65°以上であり、かつ11.5±0.2°に明瞭なピークを 有していない結晶型を有するペリレン顔料を電荷発生物 質として含有する感光層を設けて成る感光体上に一様な 帯電を付与した後、600nmにおける分光透過率が50%以 上であり、680nmにおける分光透過率が50%以下である フィルターを用いて光源光又は、光源光を原稿画像に照 射して得た反射光の長波長成分をカットして得た光を用 いて像露光を施し、前記感光体上に静電潜像を形成する 工程を有することを特徴とする画像形成方法。

> [0013] 【化2】

一般式(II)

(式中2は置換もしくは無置換の複素環を形成するのに必要な

原子群を表す。)

【0014】さらに本発明の好ましい実施態様として は、前記カットフィルターの600nmにおける分光透過率 が80%以上であり、680nmにおける分光透過率が50%以 下である特性を有し、かつ更に好ましくは750nmにおけ る分光透過率が10%以下であるという特徴を有するもの とされる。

【0015】前記特定構造のペリレン顔料を表す一般式 〔I〕及び一般式〔II〕において、Zで表される2面の 芳香族環の好ましい例としては、例えばベンゼン環、ナ フタレン環、アントラセン環、フェナンスレン環、ピリ ジン環、ピリミジン環、ピラゾール環、アントラキノン※

※環等が挙げられ、特にベンゼン環又はナフタレン環であ ることが好ましい。又、乙で表される前記芳香族環は置 換されていてもよく、置換基としては、アルキル基、ア ルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アシール 基、アシロキシ基、アミノ基、カルバモイル基、ハロゲ ン基、ニトロ基、シアノ基などを挙げることができる。 【0016】以下本発明に好ましく用いられるペリレン 顔料の具体例を化3に示すが、本発明はこれらによって 限定されるものではない。

[0017]

【化3】

. 5			6
例 示 化合物 Na.	Z	例 示 化合物 No.	Z
A - 1		A – 12	C4H9
A – 2	CH ₈	A-13	
A - 3	CH ₃ CH ₃	A -14	CH ₃
A – 4	02N	A -15	
A - 5	Ce C	A-16	
A - 6	Br S	A -17	
A – 7	CH₃0 CH₃0	A – 18	N N
A – 8	CH ₃ O	A - 19	N.J.
A - 9	CH ₃	A -20	\bigcirc
A -10	CH ₅ 0		
1,_1,		A -21	

【0018】一般に高感度な感光体特性を得るためには 第一にキャリア発生物質の微粒化された均一な塗布膜を 得ることが必要である。すなわち分散微粒化工程でまず 40 重要となるのはキャリア発生物質を微粒化することであ

【〇〇19】分散微粒化を行うことにより結晶子サイズ がある大きさ以下になってくるとX線回折スペクトルに おいて回折ピークのブロードニングとピーク強度の低下 が起こる。本発明のペリレン顔料の ρ 型結晶は $Cu-K\alpha$ 線に対するX線回折スペクトルにおいて6.3±0.2°,1 2.4±0.2°, 25.3±0.2°, 27.1±0.2°のピークが特徴 であるが、この他に11.5±0.2°に固有のピークが存在 する。 / 型結晶を分散微粒化していくとピーク全体のブ*50 ある場合が多く、又、昇華したものでは25~28°のピー

*ロードニングをみることができるが、特に本発明におい て重要であるのは、12.4±0.2°のピークの半値幅が0.6 5 以上になることであり、このようにブロードニング した12.4±0.2° のピークによって11.5±0.2° のピーク が埋もれてしまい、11.5±0.2°の領域にピークが認め られなくなる必要がある。ただし、12.4±0.2°のピー クの半値幅が1.5°を越えるとρ型結晶状態とはいえな くなる。

【0020】又、本発明のペリレン顔料の感光体特性は X線回折スペクトルにおけるピークの相対強度によって 特徴づけられる結晶状態に依存する。該ペリレン顔料 は、合成した段階では6.3°付近のピーク強度が最大で

ク強度が最大となる場合と12.4°のピーク強度が最大となる場合がある。しかしこれらを有機溶媒中で分散微粒化すると各ピークの相対強度は変化し、したがって感光体特性が変化していくが、本発明の結晶はX線回折スペクトルの12.4±0.2°のピーク強度が最大となるようにすることにより特に優れた感度特性を得ることができる。

【0021】すなわち本発明では p型結晶の12.4±0.2°のピークの半値幅が0.65°以上であり、かつ11.5±0.2°に明瞭なピークを示さない状態まで微粒化したうえで、12.4±0.2°のピーク強度が最大である状態が用いられる。

【0022】キャリア発生物質のこのような結晶状態を得るための方法は特に限定されないが、乾式粉砕法に見られるような電子写真画像の欠陥を防止するために最も優れた方法は、昇華精製したペリレン顔料を硫酸を用いてアシッドペースト処理(アモルファス化もしくは低結晶化)し、これを親和性の高い有機溶媒中でポリマーバインダを介在させながら穏やかに分散することによって結晶成長させながら目的の結晶状態にするものである。この方法においては均一な微粒化が達成され、又、機械的衝撃が小さいために結晶欠陥の導入による特性低下が避けられる。

【0023】一般式〔1〕又は〔11〕に対応する構造式 (1)及び(2)のペリレン顔料(A-1)はペリレン -3,4.9,10-テトラカルボン酸二無水物と。フェニレンジ アミンの脱水縮合反応によって合成できる。

[0024]

【化4】

精造式 (1)

構造式 (2)

【0025】合成されたペリレン顔料は不純物を除去するために昇華精製にかけられる。昇華操作は1回から5~6回程度の範囲で繰り返されるが、望ましくは2回以上の繰り返しを行う方が良い。昇華精製を行わないで塗布液を調製した場合は本発明の結晶状態を得ることが難しい。昇華して得られたペリレン顔料はX線回折スペクトルにおいてシャープなピークパターンを示し、結晶化度の高い状態であることが確認される。

【0026】昇華精製して得られた高結晶化度のペリレン顔料は硫酸を用いたアシッドペースト処理を行うことにより結晶化度の低い状態に変換される。すなわち濃硫 50

酸に溶解した後、その溶液を水もしくはメタノール等の 貧溶媒にあけて析出させ、これをろ過、乾燥して低結晶 性の微粒子粉末を得るものである。

【0027】アシッドペースト処理後の低結晶性粉末はペリレン顔料に対する親和性の高い溶媒中で適当な分散機を用いて分散処理が行われる。親和性の高い溶媒としては炭素数4~8のケトン系溶媒もしくは炭素数2~4のハロゲン化炭化水素溶媒が有用である。なかでも特に好ましい溶り、メチルイソプロピルケトン、メチルイソブチルケトン、メチルイソプロピルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、ジクロルエタン、トリクロルエタンを挙げることができる。又、この分散処理においては適当なバインダポリマーの存在によって良い結果を与えることができる。

【0028】特に望ましいバインダポリマーとしてはポリビニルビチラールやポリビニルホルマールなどのポリビニルアセタール樹脂、塩化ビニルー酢酸ビニル系樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂及びメタクリル樹脂、アクリル及びメタクリル共重合樹脂、シリコーン樹脂、シリコーン共重合樹脂、ポリスチレン、スチレン共重合樹脂、フェノキシ樹脂、フェノール樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂等を挙げることができる。

【0029】このような方法で得られた分散塗布液において本発明の特定の結晶状態が実現される。この方法においては昇華精製による高純度化が分散時の結晶状態調整に重要となっており、さらにこれを硫酸によるアシッドペースト処理によってアモルファス化し、分散処理の30 過程ではアモルファス状態(もしくは低結晶性の状態)から特定の溶媒効果によって結晶成長させており、このことによって従来とは全く異なった観点から本発明の特定の結晶状態を安定して得られるようにしたものである。

【0030】得られた分散塗布液を用いて感光体が作られる。感光体中において本発明の結晶状態が実現されているかどうかは感光体から剥離したペリレン顔料のX線回折スペクトルを測定することで確認できる。又、感光体塗布の過程においては結晶状態の変化は起きないので分散塗布液から溶媒を除去してX線回折スペクトルを測定しても確認となる。

【0031】これらのサンプルはCu-Kα線をX線源とした粉末X線回折測定装置によって測定され、ブラッグ角2θの関数として回折線強度分布が得られる。このとき試料量が十分な場合はピーク強度間の相対強度比は試料量によって変化しないが、試料量が少なくなると低角度側のピーク強度が相対的に大きくなる。したがって測定においてはピーク強度比が試料量によって変化しない程度に十分な量の試料を用いなければならない。

【0032】ここでのピーク強度は図1に示したように

ノイズを含んだベースラインレベルからの立ち上がり点 aとbを結ぶ線分と頂点cからおろした垂線との交点d を起点としたときの頂点cまでの高さ(線分cdの長 さ)で定義されるものとする。又、ピークの半値幅は点 dを起点として c d/2の高さの位置におけるピーク幅 として定義される。

【0033】感光体の層構成は種々の形態が知られてお り、本発明の感光体はそれらのいずれの形態もとりうる が、積層型もしくは分散型の機能分離型感光体とするの が望ましい。この場合、通常は図2(イ)~(へ)のよ 10 のフィルム形成性高分子重合体を用いるのが好ましい。 うな構成となる。(イ)に示す層構成は、導電性支持体 1上に本発明に係るペリレン顔料から成る電荷発生物質 を含有する電荷発生層2を形成し、これに電荷輸送物質 を含有する電荷輸送層3を積層して感光層4を形成した ものであり、(ロ)はこれらの電荷発生層2と電荷輸送 層3を逆にした感光層4を形成したものである。(ハ) 及び(二)は(イ)及び(ロ)の層構成の感光層4と導 電性支持体1の間に接着層、バリア層などの中間層5を 設けたものである。(ホ)の層構成は電荷発生物質を電 荷輸送物質とバインターを含有する層に分散した感光層 20 P-7) ポリスチレン 4を導電性支持体上に形成したものであり、(へ)は (ホ)の層構成の感光層4と導電性支持体1の間に中間 層5を設けたものである。図2(イ)~(へ)の構成に おいて、最表層にはさらに保護層を設けてもよく、又、 電荷発生層2中に電荷輸送物質を含有していてもよい。 本発明においては電荷発生層2上に電荷輸送層3を積層 して成る負帯電性感光体とされるのが好ましい。

【0034】前記電荷発生層2は、例えば下記のように して作成された塗布液を支持体1、或いは必要に応じて 接着層若しくはバリア層などの中間層5を設けた上に塗 30 布加工して得られる。

【○○35】●前記電荷発生物質を適当な溶媒に溶解し た溶液、あるいは更に必要に応じてバインダー樹脂及び /又は電荷輸送物質を加え混合溶解した溶液。

【0036】②前記電荷発生物質をボールミル、サンド グラインダー等を用いて分散媒中で微細粒子 (好ましく) は粒径5μm以下、更に好ましくは1μm以下)とし、必 要に応じてバインダー樹脂及び/又は電荷輸送物質を加 え混合分散した分散液。

【0037】電荷発生層2の形成に使用される溶媒ある 40 いは分散媒としては、n-ブチルアミン、ジエチルアミ ン、エチレンジアミン、イソプロパノールアミン、トリ エタノールアミン、トリエチレンジアミン、N,N-ジメチ ルホルムアミド、アセトン、メチルエチルケトン、メチ ルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、ベンゼン、ト ルエン、キシレン、クロロホルム、1,2-ジクロロエタ ン、1,2-ジクロロプロパン、1,1,2-トリクロロエタン、 1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラ クロロエタン、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、 ジオキサン、メタノール、エタノール、イソプロパノー 50 10

ル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ジメチルスルホキシド、 メチルセロソルブ等が挙げられるが、本発明はこれらに 限定されるものではない。

【0038】又、少なくとも電荷輸送物質を含有する電 荷輸送層3は上記電荷発生層2と同様にして形成するこ とができる。

【0039】電荷発生層2あるいは電荷輸送層3の形成 に用いられるバインダー樹脂は任意のものを用いること ができるが、疎水性で、かつ誘電率が高く、電気絶縁性 このような高分子重合体としては、例えば次のものを挙 げることができるが、これらに限定されるものではな

【0040】P-1) ポリカーボネート

- P-2) ポリエステル
- P-3) メタクリル樹脂
- P-4) アクリル樹脂
- P-5) ポリ塩化ビニル
- P-6) ポリ塩化ビニリデン
- - P-8) ポリビニルアセテート
 - P-9) スチレン-ブタジエン共重合体
 - P-10) 塩化ビニリデン-アクリロニトリル共重合体
 - P 11) 塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体
 - P-12) 塩化ビニル-酢酸ビニル-無水マレイン酸共重 合体
 - P-13) シリコーン樹脂 ·
 - P-14) シリコーン-アルキッド樹脂
- P-15) フェノールホルムアルデヒド樹脂
- P-16) スチレン-アルキッド樹脂
 - P-17) ポリ-N-ビニルカルバゾール
 - P-18) ポリビニルブチラール

これらのバインダー樹脂は単独であるいは2種以上を混 合して用いることができる。

【0041】以上のようにして形成された電荷発生層2 において、顔料とバインダー樹脂との混合割合は、該顔 料とバインダー樹脂との重量比で100:1~1000とさ れ、ペリレン顔料の含有割合がこれより少ないと光感度 が低く、残留電位の増加を招く。

【0042】又、電荷発生層2中に電荷輸送物質を含有 する場合には、電荷発生物質と電荷輸送物質との割合は 重量比で10:1~1000であることが好ましく、特に好ま しくは10:1~100である。

【0043】形成される電荷発生層2の膜厚は、好まし くは0.01~10μmである。

【0044】又、前記のようにして形成される電荷輸送 層3において、電荷輸送物質は電荷輸送層3中のバイン ダー樹脂100重量部当り20~200重量部が好ましく、特に 好ましくは30~150重量部である。

【0045】又、形成される電荷輸送層3の厚さは、好

ましくは5~60μπ、特に好ましくは10~40μπである。 【0046】本発明に用いられる電荷輸送物質として は、特に制限はないが、例えばオキサゾール誘導体、オ キサジアゾール誘導体、チアゾール誘導体、チアジアゾ ール誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導 体、イミダゾロン誘導体、イミダゾリジン誘導体、ビス イミダゾリジン誘導体、スチリル誘導体、ヒドラゾン化 合物、ピラゾリン誘導体、アミン誘導体、オキサゾロン 誘導体、ベンゾチアゾール誘導体、ベンズイミダゾール 誘導体、キナゾリン誘導体、ベンゾフラン誘導体、アク 10 リジン誘導体、フェナジン誘導体、アミノスチルベンゼ ン誘導体、ポリ-N-ビニルカルバゾール、ポリ-1-ビニル

【0047】前記電荷輸送層3に含有される電荷輸送物 質としては、光照射時に発生するホールの感光体表面へ の輸送能力の外、前記本発明に係る特有のペリレン顔料 から成る電荷発生物質との、組み合わせも考慮して選択 されるのが好ましく、かかる電荷輸送物質としては、例 えば特開昭58-65440号及び特開昭58-198043号公報記載 のスチリル系化合物、特開昭58-134642号公報及び特開 昭59-166354号公報に記載される環状ヒドラゾン化合 物、特開昭57-67940号及び特開昭57-101844号公報に記 載される鎖状ヒドラゾン化合物、特開昭57-148750号公 報に記載されるカルバゾール系化合物又は特開昭64-322 65号公報記載のジスチリル系化物が挙げられる。

ピレン、ポリー9-ビニルアントラセン等が挙げられる。

【0048】本発明に係る感光体に用いられる導電性支 持体1としては、合金を含めた金属板、金属ドラム又は 導電性ポリマー、酸化インジウム等の導電性化合物や合 金を含めたアルミニウム、パラジウム、金等の金属薄層 紙、プラスチックフィルム等が挙げられる。接着層ある いはバリヤ層などの中間層5としては、前記バインダー 樹脂として用いられる高分子重合体のほか、ポリビニル アルコール、エチルセルロース、カルボキシメチルセル ロース、ポリアミドなどの有機高分子物質又は酸化アル ミニウムなどが用いられる。

【0049】なお、本発明に係る感光体では電荷発生物 質の電荷発生機能を改善する目的で感光層4中に例えば 特開昭60-172044号公報等に記載される有機アミンを電 荷発生物質の1倍以下、好ましくは0.2倍~0.005倍含有 40 せしめることができる。又、感度向上、残留電位乃至反 復使用時の疲労低減を目的として、電荷発生層2中に上 記公報記載の電子受容性物質を電荷発生物質100重量部 に対して0.01~200重量部、好ましくは0.1~100重量部 含有せしめることができる。さらに又、必要により感光 層を保護する目的で表面保護層を設けてもよい。

【0050】次に本発明の画像形成方法においては、露 光用光源として通常蛍光灯,白熱灯、好ましくは図3に 示す如く発光波長特性を有するハロゲンランプが用いら れるが、これらは何れも600nm以上の赤外領域に及ぶ長 12

波長成分を含んでいる。そのために前記長波長領域に感 光波長域を有する前記本発明に係る感光体では赤画像を 含む原稿画像を複写したとき前記赤画像部が欠落又は濃 度不足を生ずると云う問題がある。

【0051】そこで本発明では像露光の光路中に光源か らの光を特定波長域に限定する例えば図4の如く分光透 過特性を有するフィルターを設け、該フィルターを介し て680nm以下の波長成分を主成分とし、実質的に長波長 成分を含まない光で像露光を行うようにしている。前記 像露光は、好ましくは波長680nmの光強度が、光源光の6 80nmにおける波長成分の50%以下であり、波長750nm以 上の波長成分が光源光の750nm以上の波長成分の10%以 下となるように制限される。

【0052】前記光源光の長波長光カットフィルター は、例えば長波長成分をカットする染料をポリスチレン 等の樹脂粉と共に射出成型機により板状に射出成型して 得られる。前記染料としては、例えば特開昭62-10074号 公報記載のナフトキノン染料、特開昭63-81164号公報記 載のアントラキノン染料等が用いられる。しかし前記染 20 料を用いたカットフィルターは耐光性に劣り、使用中褐 色化して性能が劣化するので、好ましくは干渉フィルタ ーが用いられる。

【0053】前記干渉フィルターは透明基板上にZnO, T iO2, MgO, ZnS等の金属酸化物又は金属硫化物をλ/4の 層厚に複数層積層して蒸着又はスパッタリングして形成 される。又、フィルター面積が小さくて済み、フィルタ 一効果が優れていることから、通常光路中の結像レンズ 面に前記干渉膜を形成したものが適している。

【0054】以下、前記感光体を用い本発明に係る長波 を塗布、蒸着あるいはラミネートして、導電性化された 30 長カットフィルターを用いた画像形成方法を説明する。 【0055】図5は本発明の画像形成方法を説明する画 像形成装置の概要図であり、10は原稿台、11は赤、黒の 原稿、12は像露光用光学系である。13及び14は固定原稿 を速度Hで走行して光照射するハロゲンランプ等の光源 及びミラーであり、15及び16はH/2の速度で走行するV ミラーである。17は本発明に係る長波長光カット干渉膜 を有する結像用レンズであり、該干渉膜に代えて干渉フ ィルター板19とすることもできる。前記本発明に係るフ ィルターにより制限された光は反射ミラー18により折曲 げられ、像露光しとして帯電器11により一様帯電が付与 された感光体ドラム20上に像様に露光されて静電潜像が 形成される。前記感光体ドラム20は感光層中に本発明に 係るペリレン顔料を電荷発生物質として含有するもので あり、通常前記感光層上には-400~-1000V程度の表 面電位が付与され、前記長波長光成分が実質的にカット された像露光が施されて静電潜像が形成され、該静電潜 像は現像装置12により-50~-300VのDCバイアス26 の印加下に現像されてトナー像が形成される。なお13は 磁気ブラシ現像ローラ、14は撹拌装置、15はトナー補給 50 用ホッパー、Tは二成分系現像剤である。

【0056】前記トナー像は給紙装置から給紙され、タイミングロール27によりタイミングを合せて供給された転写紙P上に転写極28の作用で転写され、分離極29により分離され、搬送ベルト30により定着装置31へと搬送され、定着後複写画像として排出される。

【0057】トナー像転写後の感光体ドラム20は除電器32により除電された後クリーニング装置33のクリーニングブレード34により清掃され、消去ランプ35により残留電荷が除去されて次の像形成に備えられる。

[0058]

【作用】以上説明した画像形成方法では、適正な長波長カットフィルターが用いられているため赤画像を含む原稿を用いた場合でも赤画像の欠落を伴わず、再現性に優れた複写画像が得られる。又、高感度、高耐久性の感光体が用いられているため例えばA4,60枚/分以上の高速複写を長期に亘り多数回繰り返して像形成を行っても疲労劣化がなく高画質で鮮明な複写画像が得られる。

[0059]

【実施例】以下本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明の実施の態様がこれにより限定されるもので 20 はない。

【0060】(合成例)ペリレン-3,4,9,10-テトラカルボン酸二無水物39.2g、0-フェニレンジアミン32.4g、α-クロルナフタレン800mlを混合し、260℃で6時間反応させた。放冷後、析出晶を沪取しメタノールで繰り返し洗浄した。加熱乾燥して例示化合物A-1を合成した

【0061】(昇華精製例)前記合成例により得られた例示化合物A-1は $5\times10^{-4}\sim5\times10^{-3}$ torrの圧力下において 500° の加熱条件下で昇華精製を行った。揮発性の不純物はシャッターを用いて除去した。得られた精製結晶はもう一度同様の昇華処理を行ってさらに高純度化した。このようにして2回の昇華操作を経たものを例示化合物A-1の昇華品(SUB品)と称する。

【0062】(アシッドペースト処理例)前記例示物A-1の昇華品20gを600mlの濃硫酸に溶解した液をグラスフィルターで沪過した後、1200mlの純水中に滴下して

14

析出させた。これを沪取し純水で十分に洗浄してから乾燥させた。こうして得られたものを例示化合物A-1のアシッドペースト処理品(AP品)と称する。

【0063】(感光体1の作製)ポリアミド樹脂「CM-8000」(東レ(株)製)30gをメタノール900mlと1-ブタノール100mlとの混合溶媒中に投入し50℃で加熱溶解した。室温に冷却した後、この液を用いて、外径108mm、長さ462mmのアルミニウムドラム上に、浸漬塗布により厚さ0.5μmの中間層を形成した。次いで、ポリビニルブチラール樹脂「エスレックBLS」(積水化学(株))6gをメチルエチルケトン(関東化学(株)製)1000ml中に溶解し、更に電荷発生物質(CGM)として前記した方法により得られた例示化合物A-1のAP品28gを混合した後、直径1mmのガラスビーズ2000gと共にサンドミル(SG)を用いて15時間分散を行い、分散液1を得た。この液を用いて前記中間層上に浸漬塗布して厚さ0.3μmの電荷発生層(CGL)を形成した。

【0064】この時得られた分散液 1 をガラスプレート上に複数回塗布し、乾燥させることにより約200μm厚の乾固膜を作製し、 $Cu-K\alpha$ 線を用いた X 線回折スペクトルの測定を行ったところ、表 1 の如くブラッグ角 2 のが $6.3\pm0.2^\circ$, $12.4\pm0.2^\circ$, $25.3\pm0.2^\circ$ 及び $27.1\pm0.2^\circ$ にピークを有すると共に、 $12.4\pm0.2^\circ$ に最大ピーク強度を有し、該ピークの半値幅が 0.86° であり、かつ $1.5\pm0.2^\circ$ に明瞭なピークを示さないことがわかった。その後電荷輸送物質(CTM)として下記構造の化合物 T-1 200gとバインダーとして下記構造の重合体樹脂 B200gとをジクロルメタン1000m1に溶解して得た塗布液を前記CGL上に浸漬塗布して20 μ m厚の電荷輸送層(CTL)を形成した。その後100でで 1 時間加熱乾燥して中間層、CGL及びCTLを有する表2の感光体1(実施例 $1\sim4$ 及び比較例 $1\sim3$ 用)を得た。

【0065】なお前記分散液1を用いたときのX線回折 スペクトル(XRD)を図6に示した。

[0066]

【化5】

15 化合物 T-1:

16

重合体樹脂 B:

$$-\left(0-\left(\begin{array}{c} \mathbf{H} \end{array}\right) - 000 \right)^{2}$$

重量平均分子量Mw=150.000

【0067】(感光体2の作製)前記分散液1の溶媒メ チルエチルケトンに代えて1.2ジクロルエタンを用いる と共に、分散用サンドミルのガラスビーズ量を2500gと し、20時間分散して分散液2を得、該分散液2を用いて CGLを形成した他は感光体1と同様にして表2の感光 体2(実施例5用)を得た。

*体1の場合と同様にして測定したところ、表1で示すよ うに12.4±0.2°に最大のピーク強度を有し、該ピーク の半値幅が0.94°であり、11.5±0.2°に明瞭なピーク を示さないことがわかった。

[0069]

【表1】 20

【0068】前記分散液2のX線回折スペクトルを感光*

分散液 CGM結晶型特性					C C M / 46 AT /16			
\perp	J HAMA	C, G	M特的空	44 FF	CGM分散条件			
No.	XRD	11.5° ピーク	MAX ピーク	半値幅 (12.4°)	仕込	溶媒	分散	
1	⊠6	0	0	0	例示化合物 (A-1)	メチルエチ ルケトン	S G ビーズ量2000 g	
		(無)	(12.4°)	(0.86°)	のAP品	107 10	15hr分散	
2		0	0	0	例示化合物 (A-1)	1,2-ジクロ ルエタン	S G ビーズ量2500 g	
		(無)	(12.4°)	(0.94°)	のA P品	NT 9 7	20hr分散	
3		0	0	0	例示化合物 (A-1)	テトラヒド ロフラン	S G ビーズ最1500 g	
		(無)	(12.4°)	(0.68°)	のAP品	L 192	10hr分散	
4		×	0	×	例示化合物 (A-1)	メチルエチ ルケトン	us	
		(有)	(12. 4°)	(0.60°)	のA P品	בין פענ	5hr分散	
5	图7	0	×	0	例示化合物 (A-1)	メチルエチ ルケトン	S G ビーズ量2000 g	
		(無)	(27.1°)	(0.68°)	のSUB品	107 17	15hr分散	

【0070】(感光体3の作製)前記分散液2の溶媒1, 2ジクロルエタンに代えてテトラヒドロフランを用いる と共に、分散用サンドミルのガラスビーズの量を1500g とし、10時間分散して分散液3を得、該分散液3を用い た他は感光体2と同様にして表2の感光体3(実施例6 用)を得た。

【0071】前記分散液3のX線回折スペクトルを感光 体1の場合と同様にして測定したところ、表1に示すよ うに12.4±0.2°に最大ピーク強度を有し、該ピークの 半値幅が0.68°であり、11.5±0.2°に明瞭なピークを 有していないことがわかった。

※段であるサンドミルに代えて超音波分散(US)を用い 40 て5時間分散した他は分散液1と同様にして分散液4を 得た。該分散液を用いた他は感光体1と同様にして表2 の感光体4(比較例4用)を得た。

【0073】前記分散液4のX線回折スペクトルを前記 感光体1の場合と同様にして測定したところ、表1に示 すように12.4±0.2°のピーク強度が最大であり、該ピ ークの半値幅が0.60°である外、11.5±0.2°に明瞭な ピークを示すことがわかった。

【0074】(感光体5の作製)前記分散液1の例示化 合物A-1のAP品に代えて例示化合物A-1の昇華品 【0072】(感光体4の作製)前記分散液1の分散手※50 (SUB品)を用いた外は分散液1と同様にして分散液 17

5を得た。該分散液5を用いた他は感光体2と同様にして表2の感光体5(比較例5用)を得た。

【0075】前記分散液5のX線回折スペクトルを前記感光体1の場合と同様にして測定したところ、表1に示すように $12.4\pm0.2^\circ$ に最大ピーク強度を有せず、 $27.1\pm0.2^\circ$ に最大ピーク強度を有し、かつ $12.4\pm0.2^\circ$ のピークの半値幅が 0.68° であり、 $11.5\pm0.2^\circ$ に明瞭なピークを有してないことがわかった。なお前記X線回折スペクトル(XRD)を図7に示した。

【0076】(静電特性評価テスト)U-BIX 5070(コニ 10 カ(株)社製)複写機に前記のようにして得た感光体ドラム1~5を表2の順序で装着し、図5の光学系12の17又は19の位置に、表3で示す分光透過率特性を有す干渉フィルターF1~F7を表2の順序で組み込んだ改造機を用い、実施例1~6及び比較例1~5の11種類の静電特性テストを行った。なお前記静電特性テストは各種類共、帯電及び露光を10万回ずつ、繰り返して行われた。又、表3の干渉フィルターF1及びF2は19の位置に設けられる干渉フィルター板であり、F3~F7は19の位置に設けられる干渉フィルター(この場合は干渉フ*20

18

*ィルター板17は不要)である。

【0077】前記静電特性テストは図5の現像装置22を取りはずし、その位置に感光体の表面電位ピックアッププローブを配置し、転写、クリーニングの各装置を離間し、帯電、露光を作動させて測定され、そのときの初期と10万回繰り返し後の黒紙電位VB、白紙電位VB、残留電位VRを表2に示した。

一クを有してないことがわかった。なお前記X線回折ス 【0078】ここで言う黒紙電位とは反射濃度1.3の黒ペクトル(XRD)を図7に示した。 紙原稿を用い、前記複写サイクルを実施したときの感光 【0076】(静電特性評価テスト)U-BIX 5070(コニ 10 体の表面電位を表し、白紙電位とは、反射濃度0.0の白カ(株)社製)複写機に前記のようにして得た感光体ドラ 紙原稿を用いたときの感光体の表面電位を表す。

【0079】(画像評価テスト)感光体ドラム及び長波 長カットフィルター又は長波長光カットレンズを表2の 如く組み込んだ改造機を用い、表2の順序で赤画像、黒 画像、白画像から成る原稿を用い、25℃,60%RHの環境 下に10万回に亘り複写を行い、そのときの画質を評価 し、その結果を表2に示した。

[0080]

【表2】

実施様態	感光体Na (分散液Na)	カットフィルター	初	初期電位		10万回後電位			
			V _b	V.	V,	V.	V.	V.	画質等
実施例 1	1	F 1	- 752	- 68	- 14	-758	- 80	- 23	良好
実施例 2	1	F 2	-761	- 53	- 12	-764	- 75	- 25	良好
実施例3	1	F 3	-758	- 72	- 18	-760	- 83	- 30	良好
実施例 4	1	F 4	-755°	- 63	- 20	- 754	- 90	- 29	良好
実施例 5	2	F 2	-763	- 62	- 18	-758	- 88	- 31	良好
実施例 6	3	F 2	-756	- 60	- 20	-760	- 85	- 33	良好
比較例1	1	F 5	-748	-141	- 60	-752	-192	- 88	3万コピーで カブリ発生
比較例 2	1	F 6	-752	- 38	- 18	-760	- 75	- 33	赤原稿 再現性不良
比較例3	1	F 7	-763	-138	- 72	-760	-184	-115	4万コピーで カブリ発生
比較例4	4	F2	-759	-143	- 83	-750	-253	-120	2万コピーで カブリ発生
比較例5	5	F 2	-764	-173	- 68	-749	-287	-145	初期からカブリ発生

【0081】 【表3】 19

フィルターNa	分光透過率%					
フィルターNG	600nm	680nm	750nm			
F 1	91. 0	5. 7	1.0			
F 2	92. 0	10.0	1.0			
F 3	55. 0	20.0	5. 0			
F 4	85. 0	43.0	3. 0			
F 5	30. 0	2. 1	1.0			
F 6	92. 0	76. 7	15.0			
F 7	45. 0	20.0	7. 0			

【0082】表2より実施例の画像形成方法では、感度及び残留電位特性が優れていて多数回の繰り返し使用で電位変化が少なく高耐久性であり、画質が優れており、特に赤画像の再現性も優れているが、比較例の画像形成方法では、感度及び残留電位特性が劣り、繰り返し使用で電位変化が大きく画像濃度低下及びカブリ増大がみられ、赤画像の濃度低下又は欠落もみられ、実用性に乏しいことが理解される。

[0083]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明の画像形成方法によれば、高感度、高耐久性の感光体が用いられていることから、高速で長期繰り返し使用に耐え、終始高画質が安定して得られると共に像露光系に適性な長波長光カットフィルター又は長波長光カットレンズが用いられているため赤画像濃度不足又は欠落がなく画像再現性に優れている等の効果が奏される。

【図面の簡単な説明】

【図1】ピーク強度、ピーク半値幅の定義を示す図。

20

【図2】(イ)~(へ)は本発明に係る感光体の断面図。

【図3】ハロゲンランプの発光波長特性を示す図。

【図4】長波長光カットフィルターの分光透過性を示す図。

【図5】本発明の画像形成方法を説明する画像形成装置の概要図。

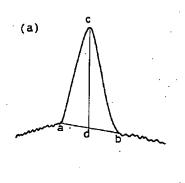
10 【図6】ペリレン顔料 (本発明内)のX線回折スペクトル図。

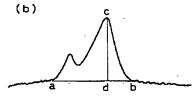
【図7】ペリレン顔料 (本発明外)のX線回折スペクトル図。

【符号の説明】

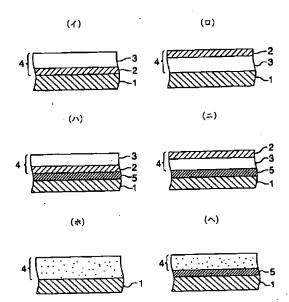
- 1 導電性支持体
- 2 電荷発生層
- 3 電荷輸送層
- 11 原稿
- 17 レンズ
- 20 19 長波長光カットフィルター
 - 20 感光体ドラム
 - 21 帯電器
 - 22 現像装置
 - 28 転写極
 - 31 定着ロール
 - 33 クリーニング装置
 - L 像露光

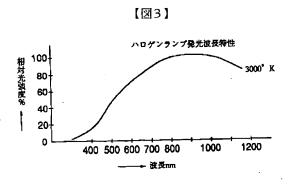
【図1】

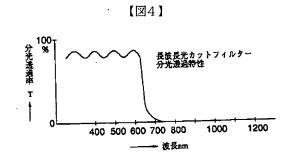


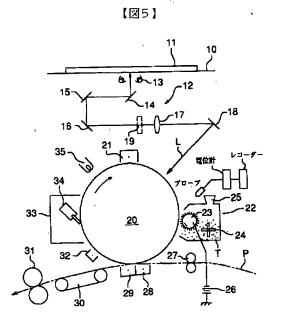


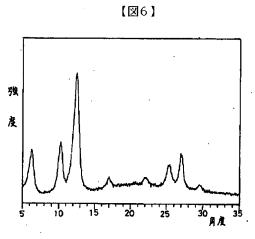
【図2】

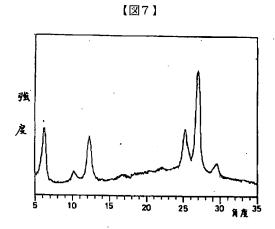












First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

End of Result Set

Generate Collection P

Print

L11: Entry 1 of 1

File: DWPI

Jan 12, 1996

DERWENT-ACC-NO: 1996-101296

DERWENT-WEEK: 199611

COPYRIGHT 2007 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Image formation by electrophotography - comprises uniformly electrifying photoreceptor having photosensitive layer on electrically conductive substrate and imagewise exposing using light source light

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

KONICA CORP

KONS

PRIORITY-DATA: 1994JP-0140362 (June 22, 1994)

Search Selected

Search ALL

Clear

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 08006277 A

January 12, 1996

012

G03G005/06

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 08006277A

June 22, 1994

1994JP-0140362

INT-CL (IPC): G03G 5/06; G03G 15/04

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 08006277A

BASIC-ABSTRACT:

Image formation comprises the steps of uniformly electrifying a photoreceptor having photosensitive layer on an electrically conductive substrate and then imagewise exposing using a light source light obtd. by cutting through a filter having spectral light transmission rate of more than 50% at 60nm and less than 50% of the same at 680nm or light obtd. by cutting long wavelength component of the light source light and reflected light obtd. by irradiating the original, so that an electrostatic latent image is formed on the photoreceptor. The photosensitive layer of the photoreceptor contains a perylene-type pigment of formula (I) or (II) having a crystalline form showing peaks of Bragg angle in X-ray diffraction spectrum against Cu-K alpha line at 6.3, 12.4, 25.4 and 27.1 degree (each has plus or minus 0.2 degree of tolerance), max. peak strength at 12.4 plus or minus 0.2 degree, more than 0.65 degree of half value of the max. peak and no obvious peak at 11.5 plus or minus 0.2 degree as charge generating material.

USE - The image formation is useful for preparing reproduction.

ADVANTAGE - The image formation has superior image reproductivity and gives image having no insufficient red image density.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/7

TITLE-TERMS: IMAGE FORMATION ELECTROPHOTOGRAPHIC COMPRISE UNIFORM ELECTRIC PHOTORECEIVER PHOTOSENSITISER LAYER ELECTRIC CONDUCTING SUBSTRATE IMAGE EXPOSE LIGHT SOURCE LIGHT

DERWENT-CLASS: E23 G08 P84 S06

CPI-CODES: E25-E; G06-F06; G06-G07; G06-G18;

EPI-CODES: S06-A01A; S06-A03;

CHEMICAL-CODES:

Chemical Indexing M4 *01*
Fragmentation Code

D011 D019 D022 D023 D029 D040 E350 G010 G019 G100

H341 H342 H541 H542 H543 H602 H603 H608 H641 H642

J5 J522 J581 J582 L9 L941 L951 L999 M122 M129

M131 M139 M150 M210 M211 M212 M214 M231 M240 M272

M280 M281 M282 M283 M320 M412 M511 M520 M530 M531

M532 M540 M781 M903 M904 Q346 Q348 R043 W003 W030

W334

Ring Index

07663 09713 58791 58794 58802 58803 58810 58811 58812 58816
66475 66478 66481 66484 66486 66509

Markush Compounds
199611-B0001-U

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1996-032437 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1996-084726

Previous Doc Next Doc Go to Doc#